

10/030866

**PRIORITY  
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1 (a) OR (b)



REC'D 03 MAY 2001

WIPO

PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

DE 01/512

**Aktenzeichen:**

100 06 787.5

4

**Anmeldetag:**

18. Februar 2000

**Anmelder/Inhaber:**

ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart/DE

**Bezeichnung:**

Einrichtung zum Schutz eines auf einem Träger-  
substrat angeordneten elektrischen und/oder elektro-  
nischen Bauteils vor elektrostatischen Entladungen

**IPC:**

H 02 H, H 05 K

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-  
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 14. März 2001  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Der Präsident  
Im Auftrag

*Jauch*

waasmaier

15.02.00 Wb/Hz

5

Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart

Einrichtung zum Schutz eines auf einem Trägersubstrat angeordneten elektrischen und/oder elektronischen Bauteils vor elektrostatischen Entladungen

Stand der Technik

15

20

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Schutz eines auf einem Trägersubstrat angeordneten elektrischen und/oder elektronischen Bauteils vor elektrostatischen Entladungen mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Merkmalen. Derartige Einrichtungen sind in der Fachwelt auch als ESD-Schutzeinrichtungen bekannt (ESD = Electrostatic Discharge).

25

30

35

Mit ESD-Schutzeinrichtungen auf Trägersubstraten wird verhindert, daß beispielsweise bei einer versehentlichen Berührung von Kontaktelementen des Trägersubstrats oder beim Aufstecken eines Steckerteils auf die Kontaktelemente oder nach Einbau des Trägersubstrats in ein elektrisches Gerät bei einer Spannungsbeaufschlagung von Gerätestecker, Kabelbaum und Aggregaten elektrostatische Entladungen und ESD-Impulse auf die mit den Kontaktelementen verbundenen empfindlichen elektronischen Bauteile des Trägersubstrats übertragen werden. Mittels der ESD-Schutzeinrichtung wird der Entladungstrom auf einen Masseanschluß abgeleitet, bevor er die Bauteile erreichen kann. Eine solche dem Oberbegriff des Anspruchs 1 entsprechende ESD-Schutzeinrichtung ist zum Beispiel aus der US 4 179 178

bekannt. Die dort gezeigte Schutzeinrichtung umfaßt ein auf das Trägersubstrat montiertes Kontaktfederelement, welches unter Vorspannung an sämtlichen Kontaktelementen des Trägersubstrats anliegt, wodurch diese zunächst kurzgeschlossen werden. Beim Aufstecken eines Steckerteils wird das Kontaktfederelement mit einem Massekontakt des Steckerteils kontaktiert und ein möglicherweise auftretender elektrostatischer Entladungstrom auf Masse abgeleitet. Beim weiteren Einschieben des Steckerteils wird das Kontaktfederelement von den Kontaktelementen getrennt und anschließend die Steckerkontakte auf die Kontaktelemente aufgeschoben, wobei nicht verhindert werden kann, daß Überspannungen die an einem einzelnen Steckerstift anliegen auf die Kontaktelemente des Trägersubstrats und von dort auf die Bauteile übertragen werden. Außerdem ist der gesamte Aufbau mechanisch relativ aufwendig und teuer.

Weiterhin sind ESD-Schutzeinrichtungen auf Leiterplattensubstraten bekannt, welche Kontaktierungsleiterbahnen von auf der Leiterplatte angeordneten elektronischen Bauteilen über Dioden, Varistoren oder Überspannungsableiter mit einem Masseanschluß elektrisch verbinden. Im Falle einer auf eine Kontaktierungsleiterbahn übertragenen elektrostatischen Entladung wird dann der Entladungstrom über die Varistoren, Dioden und Überspannungsableiter auf Masse abgeleitet. Derartige Lösungen erfordern die Bestückung der Leiterplatte mit zusätzlichen Bauelementen, die auf der Leiterplatte Platz beanspruchen und eine Änderung des Leiterbahnlayouts erforderlich machen. Zudem werden hierdurch die Herstellungskosten erhöht.

#### Vorteile der Erfindung

Die ESD-Schutzeinrichtung mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 ermöglicht einen ebenso preiswerten wie zuverlässigen Schutz von ESD-empfindlichen elektrischen und/

oder elektronischen Bauteilen, insbesondere von elektronischen Schaltkreisen, auf Trägersubstraten, wie beispielsweise Leiterplatten oder keramischen Mehrlagensubstraten. Die ESD-Schutzeinrichtung ist relativ einfach herzustellen, wobei keine teuren Spezialbauelemente erforderlich sind. Die Einrichtung umfaßt lediglich zwei elektrisch leitende Strukturen, wobei einander zugewandte Abschnitte der elektrisch leitenden Strukturen durch einen definiert hergestellten Spalt räumlich derart voneinander beabstandet sind, daß eine auf ein Kontaktelement übertragene Überspannung durch eine Funkenentladung in dem Spalt zwischen den Abschnitten übertragen und zum Masseanschluß abgeleitet wird. Die Spaltbreite kann so eingestellt werden, daß einerseits ein galvanischer Kontakt der elektrisch leitenden Strukturen zuverlässig ausgeschlossen wird und andererseits bei Überschreiten eines vorgegebenen Spannungswertes ein Funkendurchschlag auf die mit dem Masseanschluß verbundene elektrisch leitende Struktur erfolgt.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung werden durch die in den Unteransprüchen enthaltenen Merkmale ermöglicht.

Prinzipiell können die elektrisch leitenden Strukturen und der die leitenden Strukturen trennende Spalt auf verschiedenste Art hergestellt werden. Besonders vorteilhaft ist es aber, die elektrisch leitenden Strukturen in Form von auf einer gemeinsamen Hauptoberfläche des Trägersubstrats angeordneten Leiterbahnen auszubilden, welche einander zugewandte Vorsprünge aufweisen, die durch einen definiert hergestellten Spalt voneinander getrennt sind. Die Leiterbahnen können preisgünstig mit den bekannten Herstellungsverfahren auf der Hauptoberfläche des Trägersubstrats erzeugt werden. Dadurch, daß die einander zugewandten Vorsprünge der Leiterbahnen sich ausgehend von den Leiterbahnen im Querschnitt

verjüngen, wird sichergestellt, daß ein definierter Funken-  
durchschlag zwischen den einander zugewandten Enden der Vor-  
sprünge erfolgt. In einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel  
verjüngen sich die Vorsprünge im wesentlichen dreieckförmig  
und weisen einander zugewandte spitze Enden auf. Der Abstand  
5 der spitzen Enden definiert die Spaltbreite. Da die Funken-  
entladung hier unmittelbar auf der Oberfläche des Trägersub-  
strats erfolgt, wird die Durchbruchsspannung in dem Spalt  
durch Funken-Gleitentladungsvorgänge auf der Oberfläche des  
Trägersubstrats vorteilhaft vermindert.

Der Spalt zwischen den einander zugewandten Vorsprüngen der  
leitenden Strukturen kann beispielsweise mit der aus der  
Leiterplattentechnik bekannten Ätztechnik hergestellt wer-  
den. Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Spalt zwischen  
15 den einander zugewandten Vorsprüngen der ersten und der  
zweiten elektrisch leitenden Struktur durch einen in die  
Leiterbahnstrukturen des Trägersubstrats eingebrachten La-  
serschnitt hergestellt wird. Mit dem Laser können äußerst  
20 kleine Spalte mit großer Präzision gefertigt werden. Auf  
diese Weise ist es möglich, kleine Spaltbreiten bis 20 Mi-  
krometern zu realisieren, so daß schon bei kleinen Durch-  
bruchsspannungen ein Funkendurchschlag in dem Spalt erfolgt.  
Außerdem läßt sich hierdurch die Aufbauzeit für den Funken-  
25 kanal minimieren. Bevorzugt werden Spaltbreiten zwischen 30  
und 40  $\mu\text{m}$ .

In einem anderen vorteilhaften Ausführungsbeispiel ist vor-  
gesehen, als Trägersubstrat ein Mehrlagensubstrat zu verwen-  
den, wobei die erste elektrisch leitende Struktur durch eine  
30 auf einer Hauptoberfläche des Mehrlagensubstrats angeordnete  
erste Leiterbahn und die zweite elektrisch leitende Struktur  
durch eine auf einer inneren Lage des Mehrlagensubstrats an-  
geordnete und durch eine Isolierebene von der ersten Leiter-  
bahn getrennte zweite Leiterbahn ausgebildet ist und wobei  
35

in die erste Leiterbahn und die Isolierebene durch Ätzen,  
Bohren oder in anderer Weise eine sacklochartige Ausnehmung  
eingebracht ist, deren Boden die zweite Leiterbahn bildet.  
Bei diesem Ausführungsbeispiel kann weitgehend auf bei-  
5 spielsweise aus der Fertigung von keramischen Mehrlagensub-  
straten oder Mehrlagenleiterplatten bekannte Herstellungstechniken zurückgegriffen werden, ohne daß eine grundlegende  
Änderung erforderlich wäre. Der Spalt zwischen der ersten  
und der zweiten Struktur wird in diesem Fall durch die Dicke  
der isolierenden Schicht definiert, welche zwischen der er-  
sten und der zweiten Struktur angeordnet ist. Der Funken-  
durchschlag erfolgt innerhalb der luftgefüllten, sacklochar-  
tigen Ausnehmung, ausgehend von dem die Ausnehmung am oberen  
Rand umgebenden Leiterbahnabschnitt der ersten Struktur zu  
15 dem den Boden der Ausnehmung bildenden Leiterbahnabschnitt  
der zweiten Struktur.

In einem weiteren ähnlichen Ausführungsbeispiel mit einem  
Mehrlagenssubstrat ist vorgesehen, daß die erste elektrisch  
20 leitende Struktur durch eine auf einer beliebigen ersten La-  
ge des Mehrlagenssubstrats angeordnete erste Leiterbahn und  
die zweite elektrisch leitende Struktur durch eine auf einer  
zweiten Lage des Mehrlagenssubstrats angeordnete und durch  
eine Isolierebene von der ersten Leiterbahn getrennte zweite  
25 Leiterbahn gebildet wird und daß in die erste Leiterbahn,  
die Isolierebene und die zweite Leiterbahn eine das Mehrla-  
genssubstrat durchdringende Ausnehmung, insbesondere eine  
Bohrung eingebracht ist, wobei eine Funkenentladung in dem  
durch die Ausnehmung gebildeten Spalt zwischen den Innenwan-  
30 dungsabschnitten der ersten und zweiten Leiterbahn erfolgt.

Vorteilhaft kann die zweite Leiterbahn durch eine großflä-  
chige Masseebene des Mehrlagenssubstrats gebildet werden,  
beispielsweise eine durchgehende Kupferlage.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, daß die elektrisch leitenden Strukturen von zwei von dem Trägersubstrat abstehende und mit Leiterbahnen des Trägersubstrats leitend verbundenen diskreten Leiterelementen gebildet werden, deren nicht mit dem Trägersubstrat verbundene Enden einander zugewandt und durch einen definierten Spalt voneinander getrennt sind. Die Funkenentladung entsteht dann in dem Luftspalt zwischen den Enden der Leiterelemente. Diese Lösung ist zwar etwas umständlicher als die Integration der Strukturen in die Leiterbahnen des Trägersubstrats, jedoch weisen diskrete Leiterelemente, wie beispielsweise metallische Kontaktstifte eine große Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen auf, so daß durch Umwelteinflüsse bedingte Schwankungen der Spaltbreite vernachlässigbar klein sind.

Desweiteren sind auch Mischformen möglich, bei denen die erste elektrisch leitende Struktur in Form eines Leiterelementes ausgebildet ist, das mit einem ersten Ende mit einem durch Entladungsströme gefährdeten, von dem Trägersubstrat abstehenden und mit Leiterbahnen des Trägersubstrats verbundenen Kontaktelement, beispielsweise einem Steckerstift, verbunden ist und das mit einem weiteren Ende einer auf dem Trägersubstrat angeordneten, mit dem Masseanschluß leitend verbundenen und in Form einer Leiterbahn ausgebildeten zweiten elektrisch leitenden Struktur zugewandt und durch einen Spalt von dieser Leiterbahn beabstandet ist.

#### Zeichnungen

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung erläutert. Es zeigt Fig. 1 eine Draufsicht auf ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung mit einer durch Leiterbahnen auf einer Hauptober-

fläche eines Trägersubstrats ausgebildeten Schutzvorrichtung vor elektrostatischen Entladungen,

Fig. 2a und 2b ein Ausführungsbeispiel bei dem der Spalt mittels eines Lasers in die Leiterbahnstruktur eines Trägersubstrats eingebracht wird,

Fig. 3 ein Ausführungsbeispiel der ESD-Schutzeinrichtung mit zwei diskreten Leiterelementen,

Fig. 4 ein Ausführungsbeispiel mit einem Leiterelement und einer Leiterbahn,

Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel für ein Mehrlagensubstrat mit einer sacklochartigen Ausnehmung.

Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel für ein Mehrlagensubstrat mit einer durchgehenden Ausnehmung.

#### Beschreibung der Ausführungsbeispiele

Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf die Oberfläche einer Leiterplatte 1, auf welcher mehrere elektrische und/oder elektronische Bauteile 2, beispielsweise Mikroprozessoren, Speicherbauelemente, Halbleiterchips, Widerstandsbauelemente, induktive Bauelemente oder andere angeordnet sind. Die Leiterplatte 1 ist an einer Seite mit Kontaktflächen 3,4 versehen, welche zum Anschluß der Leiterplatte an ein Steckerteil dienen, wobei die Kontaktfläche 3 beispielsweise zum Anschluß einer Signalleitung und die Kontaktfläche 4 zum Anschluß eines Massekontaktes an die Leiterplatte 1 vorgesehen ist. Wie in Fig. 1 weiterhin zu erkennen ist, ist die Kontaktfläche 3 über eine Leiterbahn 13 mit dem Eingang eines Bauteile 2 verbunden. Die Kontaktfläche 4 ist über eine weitere Leiterbahn 14 mit dem Massekontakt der Bauteile 2 verbunden. Die Masseleiterbahn 14 muß nicht notwendigerweise mit dem Massekontakt der Bauteile 2 verbunden sein. Es kann sich hier um eine beliebige Leiterbahn handeln, die über das Kontaktelement 4 an Masse angeschlossen ist. Unter einem Masseanschluß ist hierbei der Anschluß an einen zur Ableitung von Entladungströmen geeigneten



Leiter zu verstehen. Dies kann auch ein metallisches Gehäuse-  
teil oder auch eine zur Ableitung von Überspannungen geeigne-  
te Versorgungsleitung sein. An den auf der Leiterplatte 1 be-  
nachbart angeordneten Leiterbahnen 13,14 sind einander zuge-  
wandte Vorsprünge 13a,14a ausgebildet, die durch einen schma-  
len Spalt 16 voneinander beabstandet sind. Wie zu erkennen  
ist, verjüngen sich die Vorsprünge ausgehend von den Leiter-  
bahnen 13,14 dreieckförmig und weisen spitze Enden auf, deren  
Abstand a die Spaltbreite definiert. Der mit den Vorsprüngen  
13a,14a und dem Spalt 16 versehene Bereich der Leiterbahnen  
13,14 bildet auf der Leiterplatte eine Einrichtung 10 zum  
Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Gelangen beispiels-  
weise die Kontaktflächen 3 mit einem elektrostatisch aufgelade-  
nen Gegenstecker oder einem anderen Ladungsträger in Kon-  
takt, so fließen die Ladungen von dort auf den Vorsprung 13a.  
Sobald die Spannung die erforderliche Durchschlagsspannung  
überschreitet, entlädt sich die Überspannung durch einen  
teilweise als Gleitentladungsvorgang ablaufenden Funkendurch-  
schlag auf den Vorsprung 14a und von dort auf den Massean-  
schluß 4. Der elektrostatische Entladungstrom kann die Bau-  
teile 2 nicht mehr erreichen. Beschädigungen werden hierdurch  
vermieden. Ohne die ESD-Schutzeinrichtung würde der Entla-  
dungsstrom über die Leiterbahn 13 ungehindert auf die Bautei-  
le 2 übertragen werden. Anstatt der hier dargestellten Lei-  
terplatte kann natürlich auch ein anders Trägersubstrat ver-  
wandt werden, beispielsweise ein Keramik-Dickschichtsubstrat,  
ein umspritztes Stanzgitter oder ein MID-Substrat. Der Spalt  
a zwischen den elektrisch leitenden Strukturen 13,14 kann in  
dem Ausführungsbeispiel von Fig. 1 mittels des aus der Lei-  
terplattenfertigung bekannten Ätzverfahrens hergestellt wer-  
den. Spaltbreiten a von weniger als 100  $\mu\text{m}$  lassen sich hier-  
durch aber kaum realisieren. In einem bevorzugten Ausführ-  
ungsbeispiel, welches in den Figuren 2a und 2b dargestellt  
ist, wird der Spalt daher mit einem Laser hergestellt. Zu  
diesem Zweck werden die Leiterbahnstrukturen zunächst, wie in

Fig. 2a dargestellt, mittels der üblichen Ätztechnik auf der Leiterplatte erzeugt. Die Leiterbahn 13 ist dabei mit der Leiterbahn 14 zunächst durch einen schmalen Leiterbahnsteg 15 verbunden. Anschließend wird, wie in Fig. 2b gezeigt, durch einen Laserschnitt in dem Steg 15 ein Spalt 16 erzeugt, durch welchen die Leiterbahnen 13 und 14 voneinander getrennt werden. Mit dem Laser können Spaltbreiten  $a$  von  $20\text{ }\mu\text{m}$  realisiert werden. Bei der bevorzugten Ausführungsform beträgt die Spaltbreite 30 bis  $40\text{ }\mu\text{m}$ .

In dem in den Figuren 1 bis 2 dargestellten Ausführungsbeispielen werden die erste und die zweite elektrisch leitende Struktur durch Leiterbahnen 13,14 auf einem Trägersubstrat hergestellt. Es sind aber auch anderer Ausführungsbeispiele möglich. Fig. 3 zeigt einen Querschnitt durch eine Leiterplatte 1 mit Kontaktflächen 3,4. Die Kontaktfläche 3 ist in nicht gezeigter Weise mit einem ESD-empfindlichen Bauteil auf der Leiterplatte verbunden. Die Kontaktfläche 4 ist mit einem Masseanschluß verbunden. Wie in Fig. 3 dargestellt ist, werden die elektrisch leitenden Strukturen durch zwei von der Leiterplatte abstehende Leiterelemente 13, 14 gebildet. Die Leiterelemente sind als gebogene Metalldrähte in Ausnehmungen der Leiterplatte befestigt und mit den Kontaktflächen 3,4 leitend verbunden. Die einander zugewandten Enden 13a,14a der Metalldrähte sind durch einen Luftspalt 16 voneinander beabstandet. Im Entladungsfall entlädt sich die an dem Leiterelement 13 anliegende Überspannung durch eine Funkenentladung in dem Luftspalt 16 auf das Leiterelement 14 und fließt von dort auf Masse ab.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel ist in Fig. 4 dargestellt. Fig. 4 zeigt eine Leiterplatte 1 mit einem Steckerstift 3, welcher in der üblichen Weise in eine Kontaktöffnung der Leiterplatte eingebracht und mit einer Leiterbahn auf der Unterseite der Leiterplatte verlötet ist, die wiederum mit einem

5

elektronischen Bauelement 2 verbunden ist. Von dem Steckerstift 3 zweigt auf halber Höhe ein stiftförmiges Leiterelement 13 ab, welches mit seinem einen Ende einstückig mit dem Steckerstift 3 verbunden ist und mit seinem von dem Steckerstift abgewandten anderen Ende 13a zur Oberseite der Leiterplatte 1 hingerrichtet ist. Auf der Oberseite der Leiterplatte ist eine Masseleiterbahn 14 angeordnet. Das Ende 13a des Leiterelementes 13 ist unmittelbar oberhalb eines Bereiches 14a der Leiterbahn 14 angeordnet und durch einen Luftspalt 16 von dem Bereich 14a getrennt. Eine bei der Einführung eines Gegensteckers auf den Steckerstift 3 übertragene elektrostatische Entladung wird durch eine Funkenentladung in dem Spalt 16 von dem Leiterelement 13 auf die Leiterbahn 14 übertragen.

15

Bei dem in Fig. 5 dargestellten Ausführungsbeispiel wird als Trägersubstrat 1 eine Mehrlagenleiterplatte oder ein keramisches Mehrlagensubstrat verwandt. Eine Leiterbahn 13 auf der Oberseite des Trägersubstrats 1 verbindet ein ESD-empfindliches Bauelement 2 mit einem nicht dargestellten Kontaktelement des Trägersubstrats, beispielsweise einem Steckerpin.

20

Eine innere Lage 14 des Mehrlagensubstrats ist als großflächige Masseebene ausgebildet. Die Masseebene 14 ist durch eine Isolierschicht 18 von der Leiterbahn 13 auf der Oberseite getrennt. Eine weitere Isolierschicht 19 trennt die Masseebene

25

von einer Leiterbahn 17 auf der Unterseite des Mehrlagensubstrats. Eine sacklochartige Ausnehmung ist in die Leiterbahn 13 und die Isolierschicht 18 eingebracht. Der Boden 14a der sacklochartigen Ausnehmung wird durch die Masseebene 14 gebildet. Im Falle einer auf die Leiterbahn 13 übertragenen

30

Überspannung liegt diese auch am inneren Rand 13a der die Ausnehmung umgebenden Leiterbahn 13 an, welche durch einen Spalt 16 vom Boden 14a getrennt ist. Durch einen Funkendurchschlag vom Rand 13a zum Boden 14a der Masseleiterbahn 14 wird die Überspannung auf Masse abgeleitet, bevor sie das Bauelemente 2 erreichen kann. Die Breite des Spalts zwischen dem

35

Rand der Leiterbahn 13a und dem Boden 14a der Ausnehmung 16a wird durch die Dicke der Isolierschicht 18 definiert.

5 Ein ähnliches Ausführungsbeispiel für eine Mehrlagenleiterplatte ist in Fig. 6 dargestellt. Die Mehrlagenleiterplatte 1 umfaßt Isolierlagen 18,19,20 und Leitungslagen. Auf zwei inneren benachbarten Lagen sind eine erste Leiterbahn 13 und eine zweite Leiterbahn 14 angeordnet, welche durch die Isolierschicht 18 getrennt sind. Die Leiterbahnen 13,14 können auf beliebigen benachbarten Lagen angeordnet sein. Wie oben ist die Leiterbahn 13 mit einem Bauelemente 2 und die Leiterbahn 14 mit dem Masseanschluß verbunden. In das Mehrlagensubstrat ist im Bereich der Leiterbahnen 13,14 eine durchgehende Bohrung eingebracht. Der die Bohrung umgebende Innenrand 13a der Leiterbahn 13 und der Innenrand 14a der Leiterbahn 14 ist durch einen durch die Bohrung in der Isolierschicht 18 erzeugten Luftspalt 16 getrennt. Im Überspannungsfall entlädt sich ein ESD-Impuls vom Innenrand 13a der ersten Leiterbahn 13 durch den Luftspalt 16 auf den Innenrand 14a der zweiten Leiterbahn 14.

15

20

15.02.00 Wb/Hz

5

Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart

### Ansprüche

1. Einrichtung zum Schutz eines auf einem Trägersubstrat angeordneten elektrischen und/oder elektronischen Bauteils vor elektrostatischen Entladungen, wobei eine im Entladungsfall an einem mit dem Bauteil (2) verbundenen Kontaktelement (3) des Trägersubstrats (1) auftretende Überspannung unter Umgehung des Bauteils auf einen Masseanschluß (4) abgeleitet wird, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Schutzeinrichtung (10) eine mit dem gefährdeten Kontaktelement (3) leitend verbundene erste elektrisch leitende Struktur (13) und eine dazu auf dem Trägersubstrat (1) benachbart angeordnete, mit dem Masseanschluß (4) leitend verbundene zweite elektrisch leitende Struktur (14) umfaßt, wobei einander zugewandte Abschnitte (13a, 14a) der elektrisch leitenden Strukturen (13, 14) durch einen definiert hergestellten Spalt (16) räumlich derart voneinander beabstandet sind, daß eine auf das Kontaktelement (3) übertragene Überspannung durch eine Funkenentladung in dem Spalt (16) von dem Abschnitt (13a) der ersten elektrisch leitenden Struktur (13) auf den Abschnitt (14a) der zweiten elektrisch leitenden Struktur (14) übertragen und zum Masseanschluß (4) abgeleitet wird.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die erste und zweite elektrisch leitende Struktur (13, 14) durch auf einer gemeinsamen Hauptoberfläche des Trägersub-

strats (1) angeordnete Leiterbahnen gebildet werden, welche einander zugewandte Vorsprünge (13a, 14a) aufweisen, die durch einen definiert hergestellten Spalt (16) voneinander getrennt sind. (Fig. 1, 2a, 2b)

5

3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die einander zugewandten Vorsprünge (13a, 14a) der Leiterbahnen sich ausgehend von den Leiterbahnen (13, 14) im Querschnitt verjüngen. (Fig. 1)

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorsprünge (13a, 14a) sich im wesentlichen dreieckförmig verjüngen und einander zugewandte spitze Enden aufweisen.

15

5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Spalt (16) zwischen den einander zugewandten Vorsprüngen (13a, 14a) der ersten und der zweiten elektrisch leitenden Struktur (13, 14) durch einen in die Leiterbahnstrukturen (15) des Trägersubstrats (1) eingebrachten Laserschnitt hergestellt ist. (Fig. 2a, 2b)

20

6. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägersubstrat (1) ein Mehrlagensubstrat ist, daß die erste elektrisch leitende Struktur (13) durch eine auf einer Hauptoberfläche des Mehrlagensubstrats angeordnete erste Leiterbahn und die zweite elektrisch leitende Struktur (14) durch eine auf einer inneren Lage der Mehrlagensubstrats angeordnete und durch eine Isolierebene (18) von der ersten Leiterbahn getrennte zweite Leiterbahn gebildet wird und daß in die erste Leiterbahn (13) und die Isolierebene (18) eine sacklochartige Ausnehmung eingebracht ist, deren Boden die zweite Leiterbahn (14) bildet, wobei eine Funkenentladung in dem durch die sacklochartige Ausnehmung gebildeten Spalt (16) zwischen dem Innenwandungsabschnitt (13b) der ersten Leiterbahn und dem Boden (14b) der Ausnehmung erfolgt.

25

30

35

(Fig. 5)

7. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägersubstrat (1) ein Mehrlagensubstrat ist, daß die erste elektrisch leitende Struktur (13) durch eine auf einer ersten Lage des Mehrlagensubstrats angeordnete erste Leiterbahn und die zweite elektrisch leitende Struktur (14) durch eine auf einer zweiten Lage des Mehrlagensubstrats angeordnete und durch eine Isolierebene (18) von der ersten Leiterbahn getrennte zweite Leiterbahn gebildet wird und daß in die erste Leiterbahn (13), die Isolierebene (18) und die zweite Leiterbahn (14) eine das Mehrlagensubstrat durchdringende Ausnehmung (16b), insbesondere eine Bohrung eingebracht ist, wobei eine Funkenentladung in dem durch die Ausnehmung (16b) gebildeten Spalt zwischen den Innenwandungsabschnitten (13b,14b) der ersten und zweiten Leiterbahn erfolgt. (Fig. 6)

8. Einrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Leiterbahn (14) durch eine großflächige Masseebene des Mehrlagensubstrats (1) gebildet wird.

9. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitenden Strukturen (13, 14) durch zwei von dem Trägersubstrat (1) abstehende und mit Leiterbahnen (3,4) des Trägersubstrats leitend verbundene diskrete Leiterelemente gebildet werden, deren nicht mit dem Trägersubstrat (1) verbundene Enden einander zugewandt und durch einen definierten Spalt (16) voneinander getrennt sind. (Fig. 3)

10. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste elektrisch leitende Struktur (13) in Form eines Leiterelementes ausgebildet ist, das mit einem ersten Ende mit einem durch Entladungsströme gefährdeten, von dem Trägersubstrat abstehenden und mit Leiterbahnen des Trägersub-

strats verbundenen Kontaktelement (3) verbunden ist und das mit einem weiteren Ende (13a) einer auf dem Trägersubstrat angeordneten, mit dem Masseanschluß leitend verbundenen und in Form einer Leiterbahn ausgebildeten zweiten elektrisch leitenden Struktur (14) zugewandt und durch einen Spalt (16) von dieser beabstandet ist. (Fig. 4)

11. Einrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Kontaktelement (3) ein Kontaktelement eines auf dem Trägersubstrat angeordneten Steckerteils ist.

12. Einrichtung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Spalt (16) zwischen zwanzig und zweihundert Mikrometern breit ist.

13. Trägersubstrat mit einer Einrichtung (10) zum Schutz eines auf dem Trägersubstrat (1) angeordneten elektrischen und/oder elektronischen Bauteils (2) vor elektrostatischen Entladungen nach einem der vorstehenden Ansprüche.



15.02.00 Wb/Hz

5

Robert Bosch GmbH, 70442 Stuttgart

Einrichtung zum Schutz eines auf einem Trägersubstrat angeordneten elektrischen und/oder elektronischen Bauteils vor elektrostatischen Entladungen

Zusammenfassung

15

Der Vorschlag bezieht sich auf eine Einrichtung zum Schutz eines auf einem Trägersubstrat angeordneten elektrischen und/oder elektronischen Bauteils vor elektrostatischen Entladungen, wobei eine im Entladungsfall an einem mit dem Bauteil verbundenen Kontaktelement des Trägersubstrats auftretende Überspannung unter Umgehung des Bauteils auf einen Masseanschluß abgeleitet wird. Es wird vorgeschlagen, daß die Schutzeinrichtung eine mit dem gefährdeten Kontaktelement leitend verbundene erste elektrisch leitende Struktur und eine dazu auf dem Trägersubstrat benachbart angeordnete, mit dem Masseanschluß leitend verbundene zweite elektrisch leitende Struktur umfaßt, wobei einander zugewandte Abschnitte der elektrisch leitenden Strukturen durch einen definierten Spalt räumlich derart voneinander beabstandet sind, daß eine auf das Kontaktelement übertragene Überspannung durch eine Funkenentladung in dem Spalt von dem Abschnitt der ersten elektrisch leitenden Struktur auf den Abschnitt der zweiten elektrisch leitenden Struktur übertragen und zum Masseanschluß abgeleitet wird.

20

25

30

35



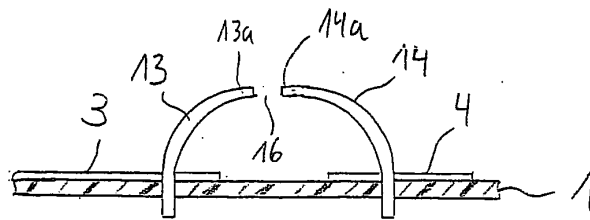


Fig. 3

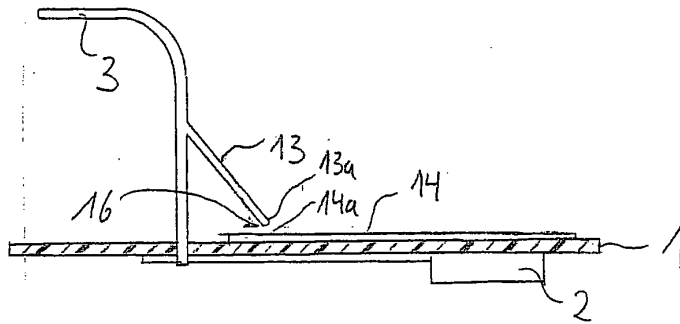


Fig. 4

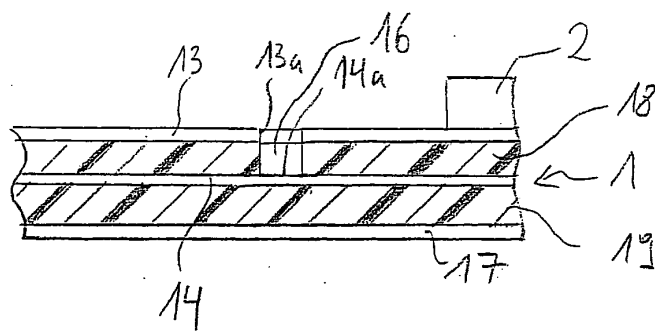


Fig. 5

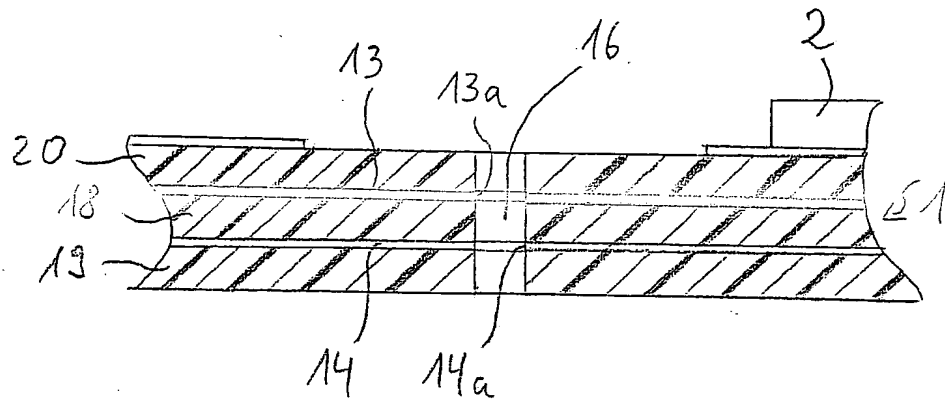


Fig. 6